

## プロセスエンジニア向け分析基礎セミナー (B-1)

本セミナーはビギナーの方を対象としたもので、事例を通して各種分析手法の特徴を理解頂き、現場での分析をより有効に使用して頂けるよう企画したものです。

尚、弊社の社員による日本語での講義となります。

参加費用：無料(ランチ付)

時 間	プ ロ グ ラ ム
10:00-10:10	1. はじめに
10:10-10:40	2. 形態観察及び微小領域分析 (1) SPM, SEM, EDS, AES
10:40-11:30	3. 形態観察及び微小領域分析 (2) FIB, TEM/STEM
11:30-12:10	4. 表面の有機汚染分析 XPS, TOF-SIMS, FT-IR, Raman
12:10-13:00	**ランチ休憩** 
13:00-13:40	5. 表面の金属汚染分析 VPD, TXRF, Surface-SIMS, TOF-SIMS
13:40-14:20	6. 薄膜組成分析 (1) Accelerator (RBS,HFS,PIXE), LEXES
14:20-15:00	7. 薄膜組成分析 (2) XRD, XRR
15:00-15:15	**アフターヌーンブレイク** 
15:15-16:00	8. 不純物深さ方向濃度分析 SIMS
16:00-16:30	9. 不純物バルク分析 GDMS, LA-ICPMS, ICP-OES, IGA
16:30-16:50	10. まとめ (適切な分析手法の選択と試料の取り扱い方)

\* プログラムは変更になる場合がございます

本プログラムの中には質疑応答の時間もございます。  
ご不明な点などございましたら、なんなりとご質問ください。

